

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成17年6月16日(2005.6.16)

【公開番号】特開2004-68056(P2004-68056A)

【公開日】平成16年3月4日(2004.3.4)

【年通号数】公開・登録公報2004-009

【出願番号】特願2002-226530(P2002-226530)

【国際特許分類第7版】

C 2 3 C 18/31

【F I】

C 2 3 C 18/31 Z

【手続補正書】

【提出日】平成16年9月15日(2004.9.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 4】

《実施例2》

下記の組成により無電解スズメッキ浴を建浴した。

・2-ヒドロキシエタン

-スルホン酸第一スズ(Sn²⁺として) : 0.25 mol/L

・2-ヒドロキシエタンスルホン酸 : 1.50 mol/L

・p-フェノールスルホン酸 : 0.85 mol/L

・チオ尿素 : 2.50 mol/L

・次亜リン酸 : 0.60 mol/L

・ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル(E015) : 5.0 g/L

本実施例2の組成を前記条件(a)~(c)に基づいて説明すると、ヒドロキシエタンスルホン酸(アニオン換算)は $1.50 + 0.25 \times 2 = 2.00 \text{ mol/L}$ 、フェノールスルホン酸は 0.85 mol/L であって、芳香族オキシスルホン酸/アルカノールスルホン酸 = $0.85 / 2.00 = 0.425$ である。

また、Sn²⁺/次亜リン酸類 = $0.25 / 0.60 = 0.41$ である。